株式会社エンプラス

２００７年３月期

P R E S E N T A T I O N

決算説明会

２００７年　４月２７日
代表取締役社長
杉 本　敏 昭

－ Resume －

- ２００７年３月期に実施した主な施策
- ２００７年３月期決算概要（連結）
- ２００８年３月期通期計画（連結）
- 各事業セグメントのビジネス動向及び計画

1

PRESENTATION

2007年3月期に実施した主な施策

2007年3月期に実施した主な施策

➢改革から成長へのゆるぎない健全経営軌道の構築

基幹事業の再構築
事業構造改革の完遂と新体制の構築
収益基盤の強化･安定化

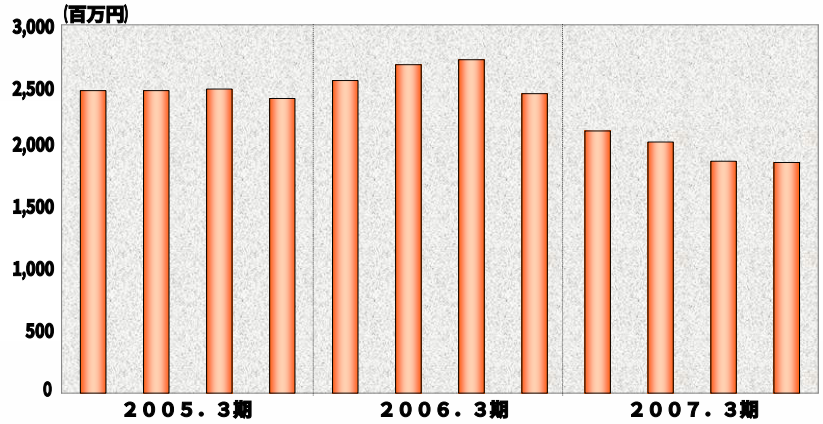
➢アジア地域を最重点としたグローバル事業の再編･最適化

中国華南にエンプラス（広州）設立
EHT(S)の生産機能をE(M)に集約
E(T)への増資による輸入販売の認可

3

収益基盤の強化・安定化

単体固定費の推移



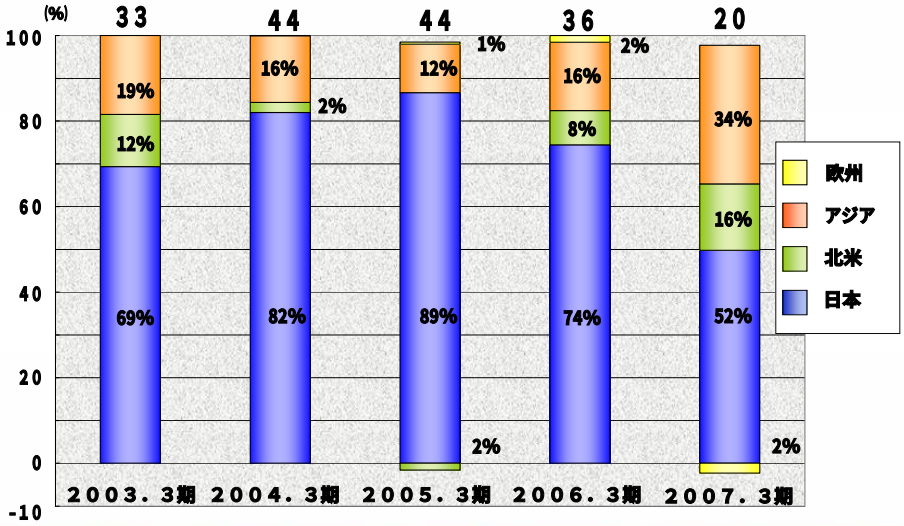
2006年3月期 下期 5,153 (百万円) △26.9% → 2007年3月期 下期 3,769 (百万円)

4

アジア地域の最適化

所在地別営業利益比率推移

(単位: 億円)



5

損益実績

（単位： 億円）

	2006年3月期 実績		2007年3月期 実績
売上高	401.8	△21.8%	314.4
（原価率）	(70.8%)		(69.2%)
営業利益	36.9	△43.3%	20.9
経常利益	38.3	△43.3%	21.7
当期純利益	15.0	△98.8%	0.1
1株当たり当期純利益	70.81円	△69.94円	0.87円
1株当たり配当	22.00円	△2.00円	20.00円

7

セグメント別売上実績

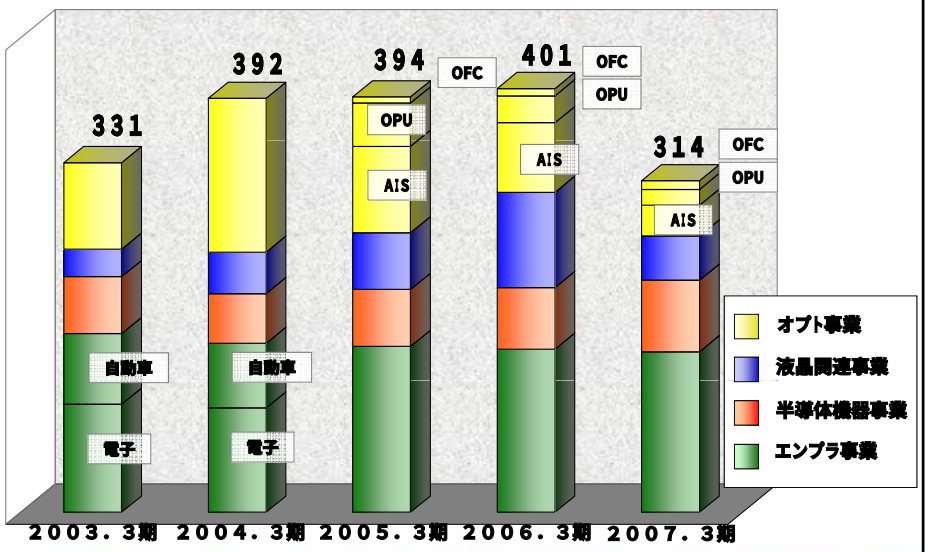
（単位： 億円）

	2006年3月期 実績		2007年3月期 実績
エンプラ事業	154.7	△1.6%	152.2
半導体機器事業	58.3	16.4%	67.9
液晶関連事業	90.4	△53.7%	41.8
オプト事業	98.3	△46.8%	52.3
計	401.8	△21.8%	314.4

8

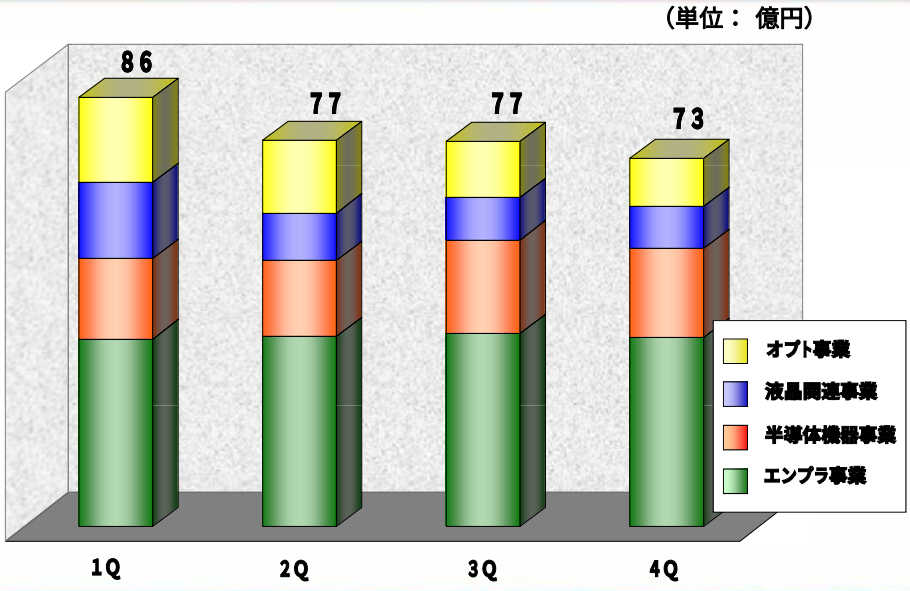
売上高推移

（単位： 億円）



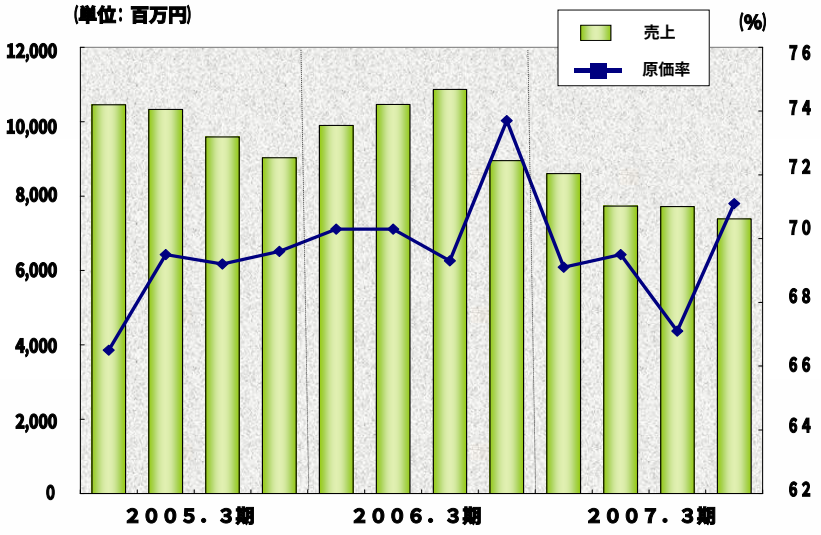
9

四半期売上高推移



10

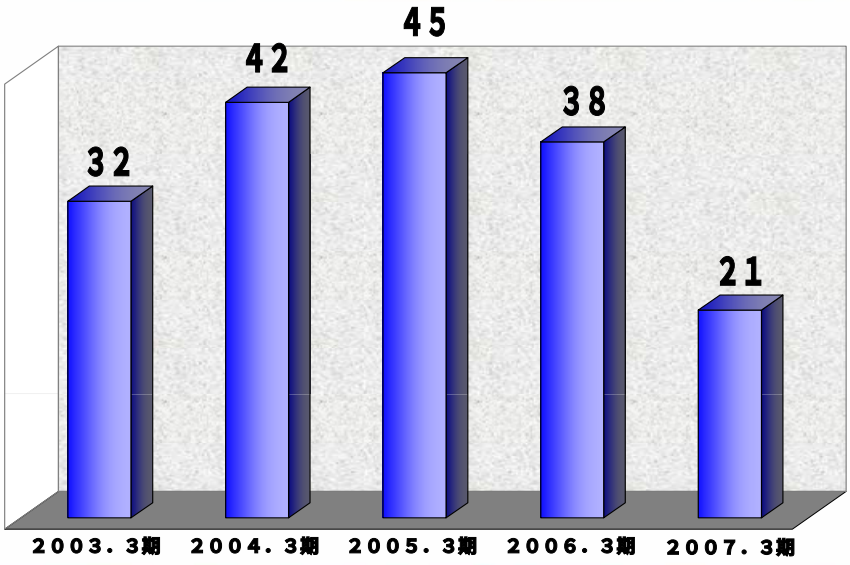
原価率推移



11

経常利益推移

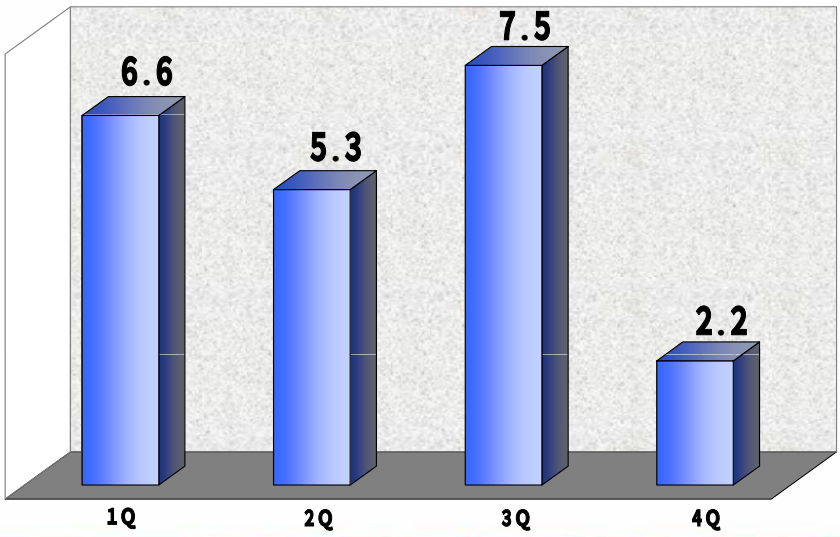
（単位： 億円）



12

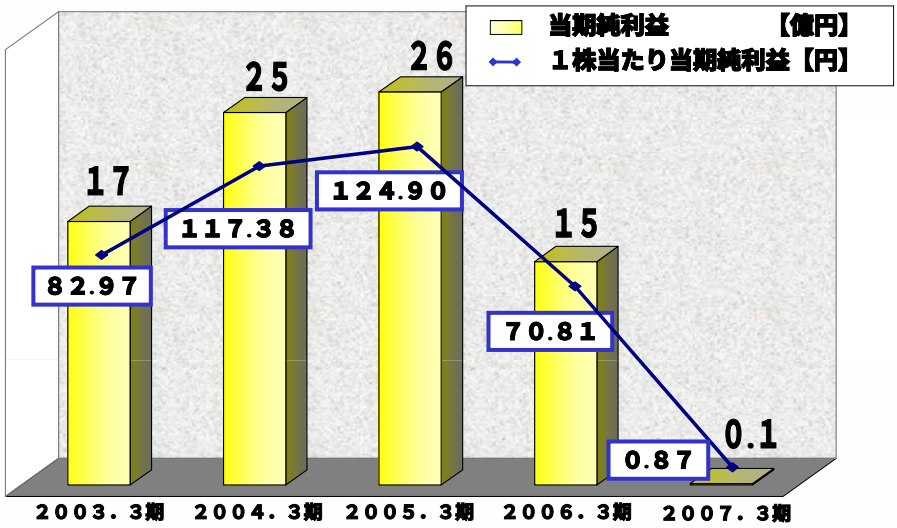
四半期経常利益推移

（単位： 億円）

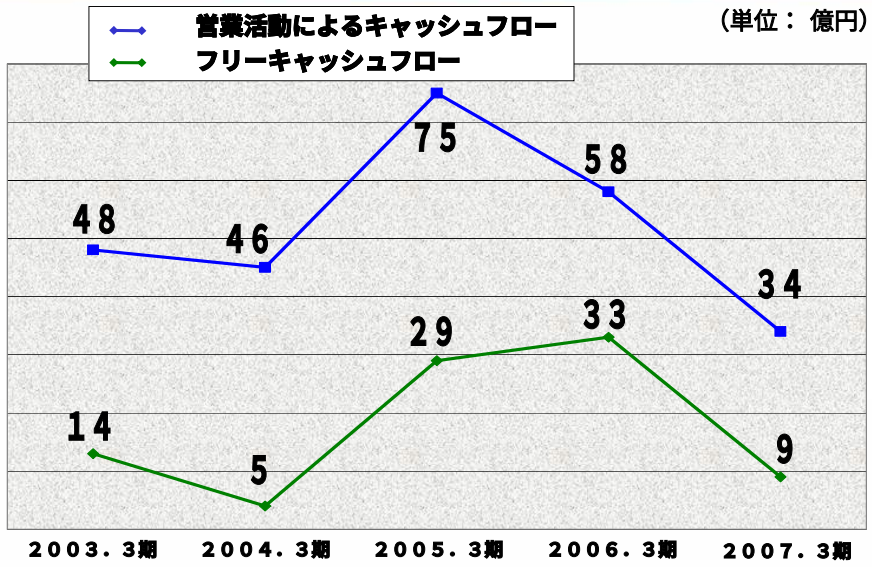


13

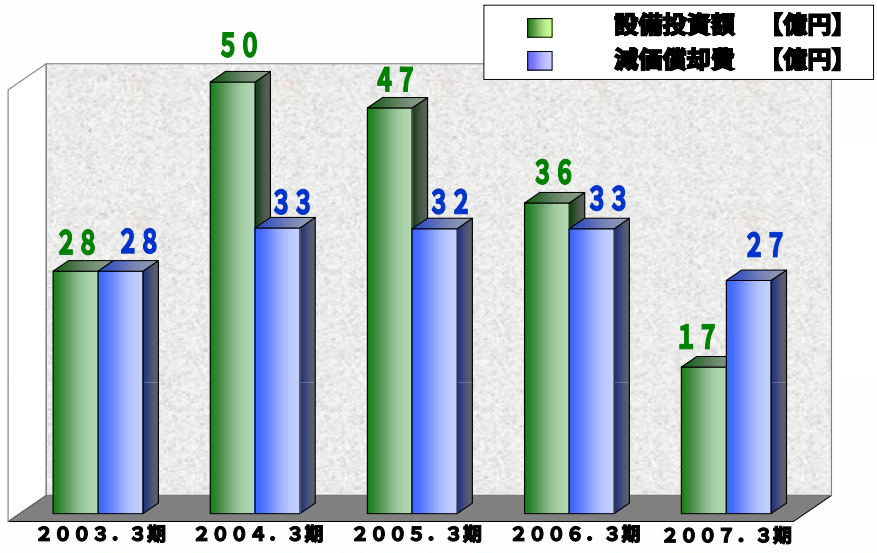
当期純利益推移



連結キャッシュフロー推移



設備投資額と減価償却費



決算概要

- 売上高　前年度比大幅減収 △8,744百万円
  （液晶関連 △4,850百万円／オプト事業 △4,600百万円）
- 売上原価率の改善　1.6ポイント
- 販管費の改善 446百万円

営業利益 前年度比 △1,600百万円

- 特別損失 1,427百万円（前年度比 ＋338百万円）
  健全性を重視した評価損 854百万円

PRESENTATION

２００８年３月期
通期計画（連結）

2008年3月期　経営基本方針

1. ニューグローバル経営戦略機構の構築
2. 基盤技術の革新と集中によるグローバル生産推進体制の構築
3. 先端技術･品質･知財の並立加速でデファクト･トップ製品の拡大
4. 新事業の創出
5. 企業価値向上直結の内部統制システムの構築

19

2008年3月期 計画

（単位： 億円）

	2007年3月期 実績		2008年3月期 計画	2008年3月期 上期計画
売上高	314.4	1.8%	320.0	(155.0)
（原価率）	(69.2%)	(0.5ポイント)	(69.7%)	(71.9%)
営業利益	20.9	5.1%	22.0	(6.5)
経常利益	21.7	5.8%	23.0	(7.0)
当期純利益	0.1	→	12.0	(3.0)
1株当たり当期純利益	0.87円	60.03円	60. 90円	(15.22円)
1株当たり配当	20.00円	0.00円	20.00円	(10.00円)

20

セグメント別 売上計画

（単位： 億円）

	2007年3月期 実績		2008年3月期 計画	2008年3月期 上期計画
エンプラ事業	152.2	5.1%	160.0	(80.0)
半導体機器事業	67.9	26.6%	86.0	(40.0)
液晶関連事業	41.8	△11.7%	37.0	(18.0)
オプト事業	52.3	△29.3%	37.0	(17.0)
計	314.4	1.8%	320.0	(155.0)

21

参考指標

（単位： 億円）

	2007年3月期 実績	2008年3月期 計画
設備投資額	17.3	25.0
減価償却費	27.1	34.0
	※ 税制改正の影響	5.0
試験研究費	12.9	13.0
（売上高比）	(4.1%)	(4.1%)

22

PRESENTATION

各事業セグメントの ビジネス動向及び計画

エンプラ事業の動向

（億円）

2007年3月期 上期実績	2007年3月期 下期実績	2008年3月期 上期計画	2008年3月期 下期計画
75	76	80	80

前期ハイライト

- ➢不採算製品からの撤退
- ➢アジア・中国地域における新たなる市場開発の推進
  - ◆エンプラ・液晶関連ビジネスを主体とした中国華南地域での事業基盤構築

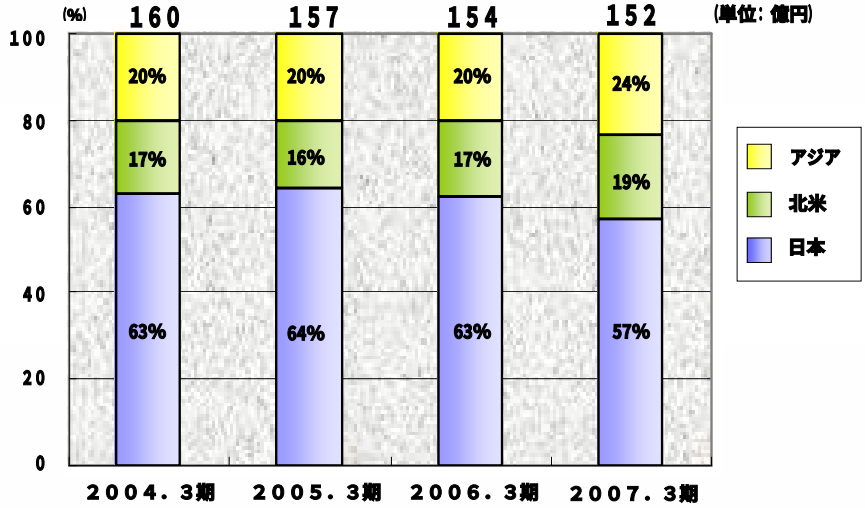
    広州(中国)に子会社設立
    Guangzhou Enplas Mechatronics Co.,Ltd.
  - ◆ベトナムでのエンプラ事業稼動

今期の戦略

- ➢精密機構部品の新規製品開発と積極的な受注獲得
- ➢顧客生産拠点の海外シフトへの対応
- ➢開発ギヤの積極提案による自動車市場への拡販

エンプラ事業の動向

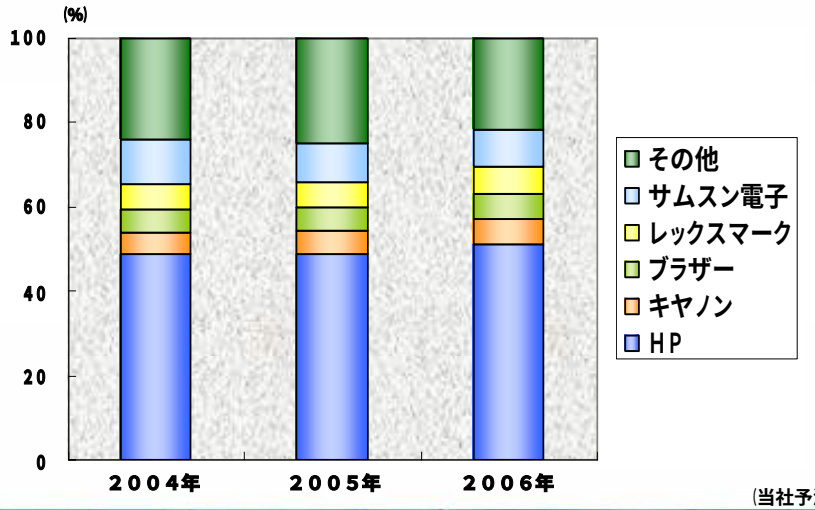
所在地別売上比率



エンプラ事業の動向－ＯＡ －

enplas

ＬＢＰの世界市場シェア

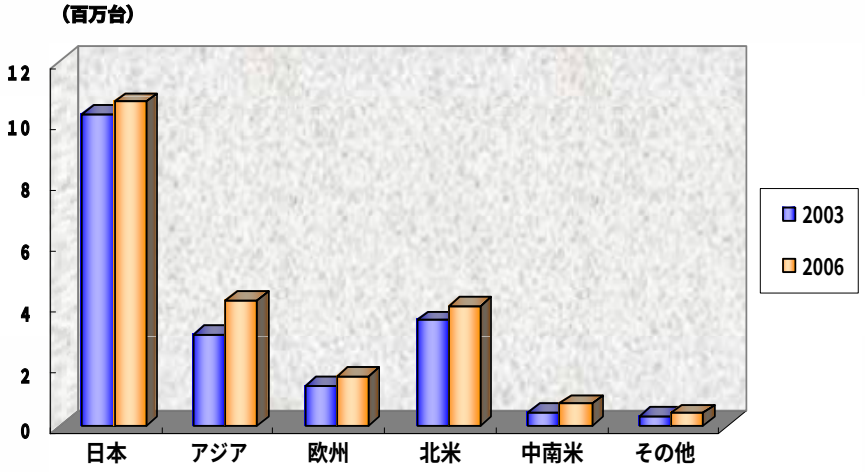


(当社予測)

エンプラ事業の動向－自動車－

enplas

日系自動車メーカーの地域別生産台数



(当社予測)

半導体機器事業の動向

enplas

（億円）

2007年3月期 上期実績	2007年3月期 下期実績	2008年3月期 上期計画	2008年3月期 下期計画
31	36	40	46

前期ハイライト

- プローブカード事業のビジネス基盤強化
- テストソケット事業の市場シェア拡大
  - ◆主要顧客との開発促進
  - ◆生産性の追及
- 最先端要素技術を応用したソケットの開発
- 高周波型ソケットビジネスの拡大

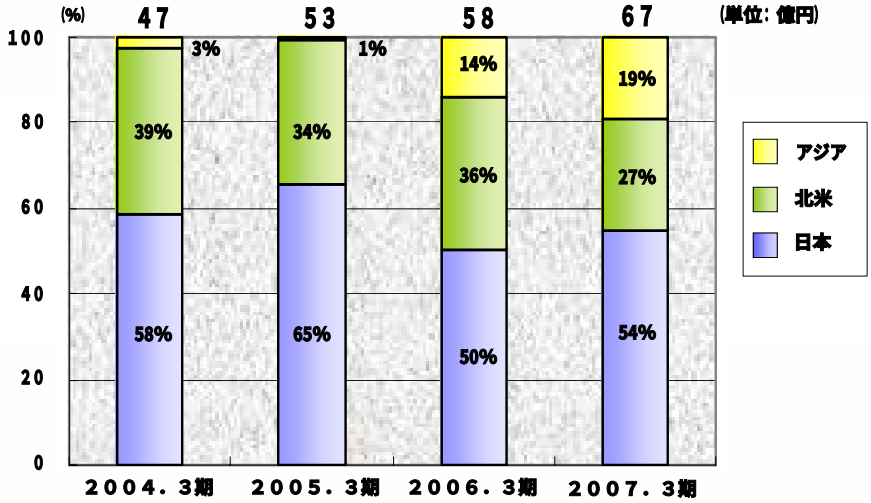
今期の戦略

- バーンインソケットのさらなるシェア拡大
- 最先端要素技術を取り込んだ狭ピッチ・多ピンソケットの継続的開発
- プローブカード事業の収益基盤の強化

半導体機器事業の動向

enplas

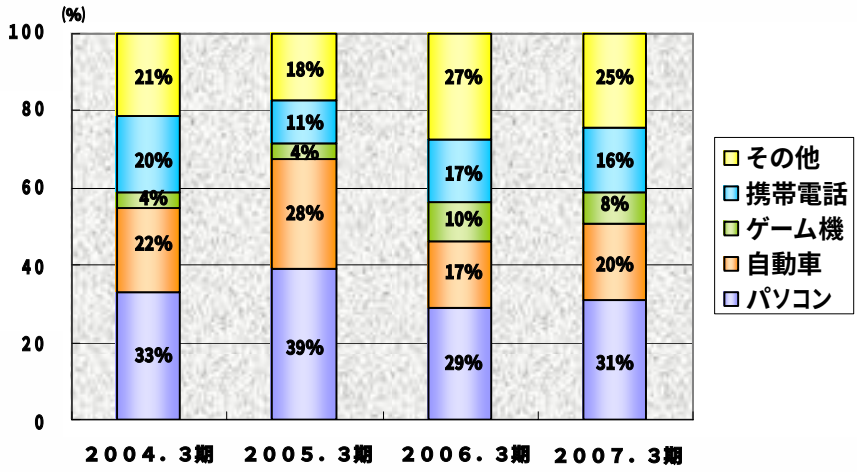
所在地別売上比率



半導体機器事業の動向

enplas

半導体用途別売上比率（単体）



半導体機器事業の動向－新製品－

enplas

ハイパワーバーンインソケット

最先端CPU･画像処理ICの高速処理

- 150～400Wの大消費電力
- 高発熱
- 2,000～4,000ピンの多数ピン

最大
約15cm

バーンインソケット

最小
約3cm

半導体機器事業の動向－新規事業－

enplas

ＬＣＤドライバー用プローブカードの開発

（直列式で４個同時測定　３０μｍ ピッチ）

- マルチ化対応　：１個　→　２個　→　４個同測化
- 狭ピッチ対応　：２０μｍ In-line ピッチへの対応

液晶関連事業の動向

enplas

（億円）

2007年3月期 上期実績	2007年3月期 下期実績	2008年3月期 上期計画	2008年3月期 下期計画
24	17	18	19

前期ハイライト

- ➢液晶市場の低迷による大幅な減収
- ➢WPS-LGP(両面プリズム導光板)の開発
- ➢小型用LGPの中国戦略強化（現地生産を視野に）

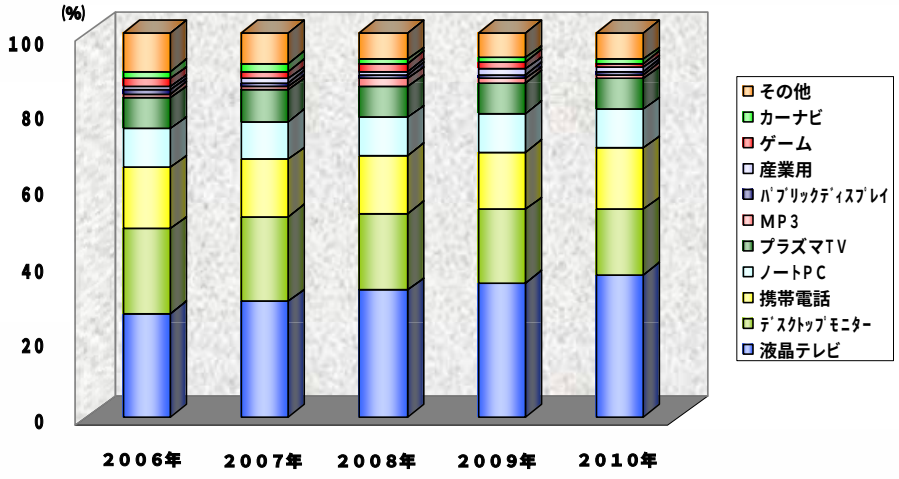
今期の戦略

- ➢ノートＰＣ用ＬＧＰシェア拡大
  - ◆ハイエンド市場向けWPS-LGPの上市
  - ◆ミドルエンドＬＧＰの開発と市場への積極参入
- ➢中小型ＬＧＰ市場の積極開拓
  - ◆ハイエンド市場向け積極展開
  - ◆中国での生産体制強化
- ➢ＬＥＤ光源用高品位ＬＧＰの開発

液晶関連事業の動向ーノートPCー

enplas

ＦＰＤ市場用途別シェア

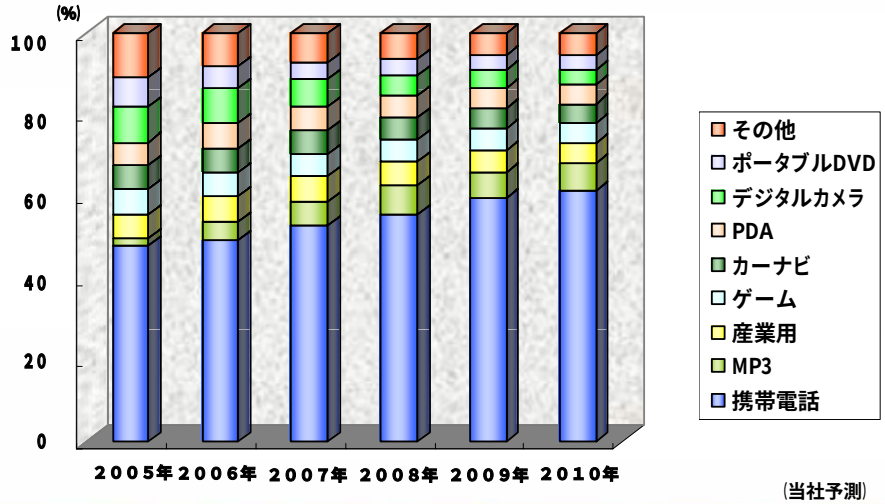


(当社予測)

液晶関連事業の動向ー中小型ー

enplas

中小型 ＴＦＴＬＣＤ市場用途別シェア



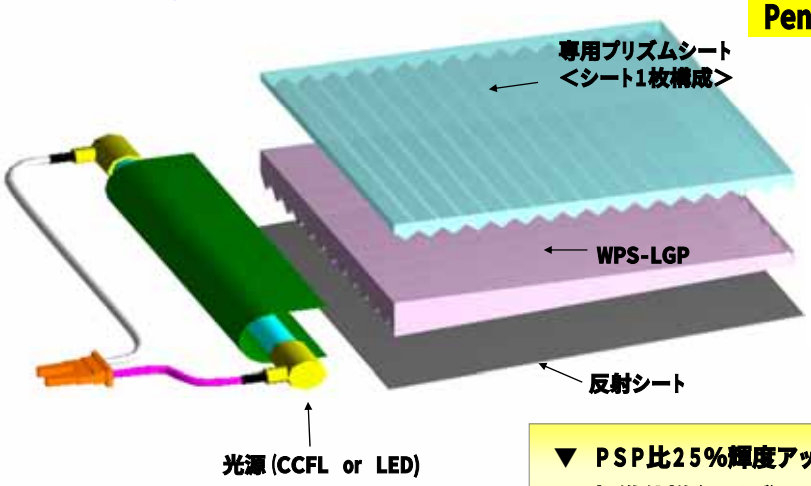
(当社予測)

液晶関連事業の動向ー新製品ー

Enplas

WPS-LGPについて

Patent Pending



▼ PSP比25%輝度アップ
▼ 標準仕様(サイズ)

オプト事業の動向

Enplas

（億円）

2007年3月期 上期実績	2007年3月期 下期実績	2008年3月期 上期計画	2008年3月期 下期計画
31	20	17	20

前期ハイライト

- ➢事業再構築の完了
  - ◆Enplas Nanotech, Inc.の清算
  - ◆中国組立事業からの撤退
- ➢コア技術に集中したAISレンズビジネスへの戦略転換の開始
  - ◆標準レンズ販売
  - ◆小型低背ビジネス
- ➢ピックアップレンズ原価低減
- ➢4G光通信の本格的普及による通信用レンズシェア拡大

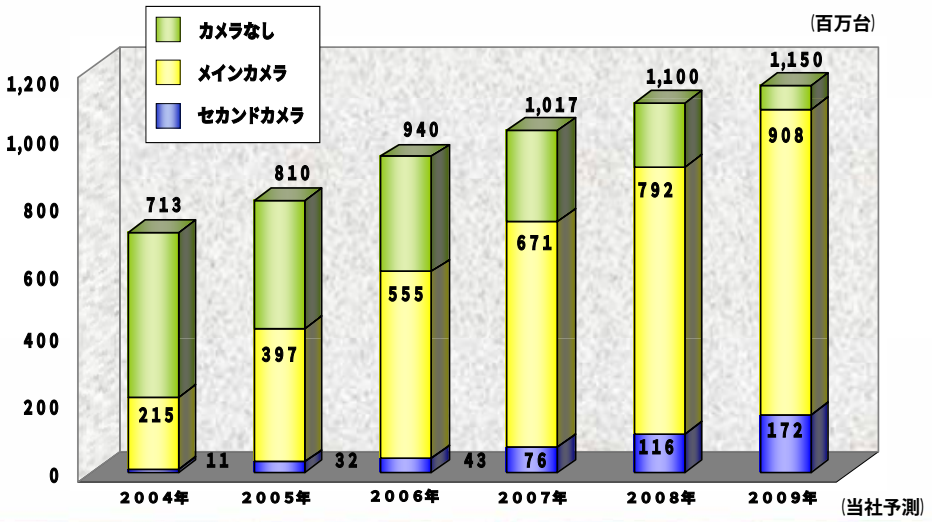
今期の戦略

- ➢コア技術をベースとした高付加価値ビジネスモデルの構築
  - ◆ＡＩＳ
    - ●高精度・高機能レンズ製造技術
    - ●小型低背レンズへの集中
  - ◆ＯＰＵ
    - ●原価低減による中国戦略強化
    - ●高機能・複合型グレーティングの開発
  - ◆ＯＦＣ
    - ●１０Ｇ対応新規通信用レンズの開発

オプト事業の動向－ＡＩＳ－

enplas

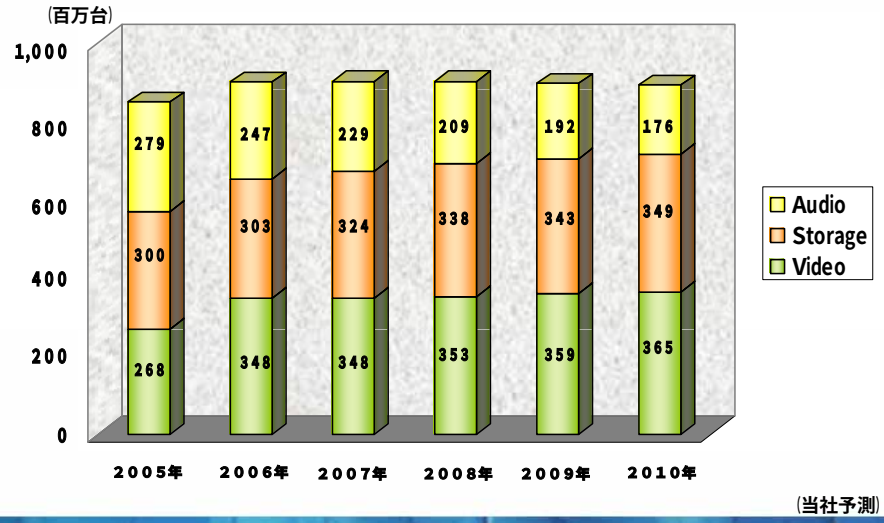
携帯電話のカメラ搭載台数推移



オプト事業の動向－ＯＰＵ－

enplas

ピックアップ市場推移



新事業の推進① バイオ分野の開拓

Enplas

Patent Pending

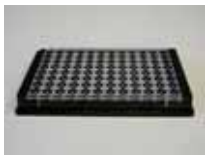
96穴独自タイタープレートの開発

① 蛋白定量用途(ELISA)：試薬量削減・感度向上→臨床検査/食品検査/抗体作製など

② 細胞/菌体培養用途：試験管/フラスコからマイクロプレート化へ

③ 蛋白質精製用途：マルチユニット化へ

独自開発96穴プレート

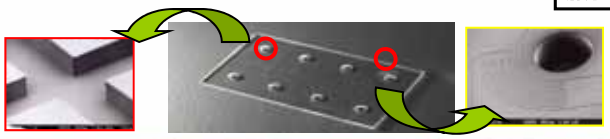


プラスチックマイクロ流路プレートの開発

① インジェクションモールドで微細かつ高転写を実現

② 高精度な封止技術により、安定流路を確保

溝幅　：50 μm
溝深さ：20 μm



新事業の推進② LED関連分野

Enplas

LED光源配光制御オプティクスの開発

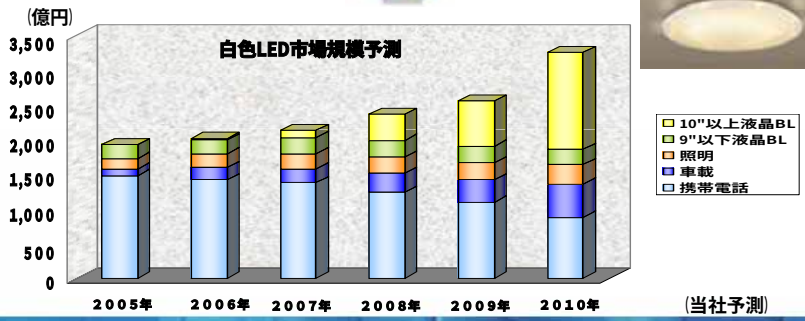
対象とする領域

① 携帯電話用バックライト、中型液晶用バックライト

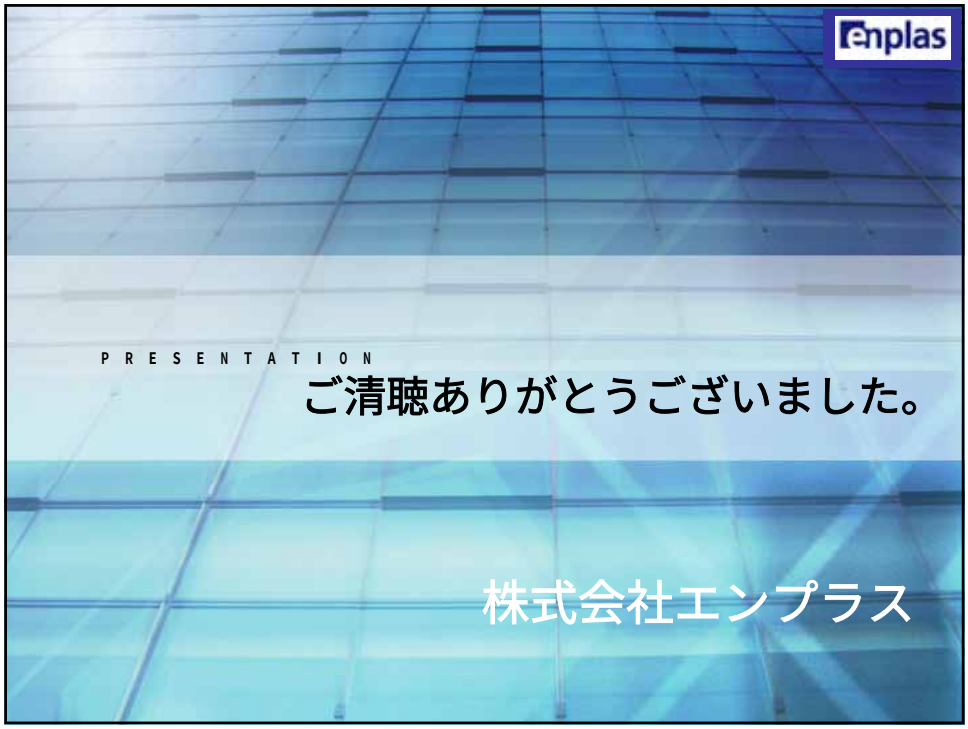
② 高輝度LED市場、特殊照明

③ 車載用（ヘッドライト・センサーetc）

④ 一般照明（蛍光灯の代替）



（当社予測）


enplas
PRESENTATION
ご清聴ありがとうございました。
株式会社エンプラス